

● レイテックスの装置戦略

検査から測定への進化図る 多様なニーズに全面展開へ

純国産バージョンを投入

レイテックスはウェーハの平坦度・ナノトポグラフィ/ロールオフ測定装置「NanoPro NP2」の新バージョン「NanoPro NP2-N」を開発した。2008年早々に出荷を開始する予定だ。

NanoPro NP2のベースは、米KLA-Tencorが2002年12月に発表した「NanoPro NP1」となる。2004年9月にレイテックスがKLA-Tencorから買収した装置だ。NanoPro NP1は独自の斜入射干渉系により、ウェーハ両面の平坦度・ナノトポグラフィ/ロールオフを測定することができる。買収時にはまだ技術的に未完成の部分があった他、使い勝手などにも課題を残していた。このため、性能面を含めてブラッシュアップに取り組んだ。当初の見込みより若干ずれ込んだが、2006年に完成し、ユーザーサイトで評価を受けていた。ユーザーからの評価は高かったが、さらなる性能の向上や機能の追加を求める声も多かった。このため、同社では従来米国で行っていたNanoPro NP2の開発・製造を日本に移し、設計を含めて全面的な刷新を実施した。部品も米国製から日本製に切り換え、設計から組立までを日本で行う“純国産”の装置となった。全面刷新により、性能や機能だけでなく、信頼性も大幅に向上した他、装置の立ち上げ期間短縮やコストダウンにもつなげたという。NanoPro NP2-Nは300mmウェーハ対応で、300mmウェーハの生産能力増強を急ピッチで進めるSiウェーハメーカー向けへの拡販を狙っている。

開発力を強化しラインナップを拡充

同社では、これまで目視での検査や検査できなかったものを自動検査するというコンセプトで様々な装置を開発してきた。これにより、Siウェーハのエッジ検査という新しいジャンルを切り開き、揺るぎない地位を築いている。今後は一歩進んだメトロロジーとして、インスペクション（検査）からメトロロジー（測定）へと進化しようとしている。単に欠陥を検出するだけでなく、しきい値

レイテックスの会社概要

設立：1988年7月19日
 代表取締役社長：高村 淳
 資本金：10億7220万円
 売上高：（2008年5月期は見込み）
 2007年5月期 59億8000万円
 2008年5月期 68億9800万円
 事業内容：ウェーハ自動検査装置の製造・販売など

を設定するなどユーザーの歩留り向上にも貢献できるような技術・装置の実現を目指している。このため、開発力の強化にも取り組んでおり、その一環として、ナノシステムソリューションズ（NSS）の子会社化なども行った。さらに、三井金属のSiウェーハ検査事業を買収、LSTDスキャナ「MO-601」やBMDアナライザ

「MO-441」をラインナップに加えている。特にMO-441は大手半導体メーカーに納入したのを契機に、引き合いが急増しており、生産が間に合わないほどだという。同装置は競合が事実上ないため、さらなる売上拡大が期待できる。

このように着実に企業としての体力は向上しており、高いハードルを設定してもクリアできるようになってきたという。今後は、さらなる信頼性向上やラインナップの充実を進めていく。また、これまではユーザーの仕様に合わせた特注品が多かったが、仕様をある程度集約し、標準化することでコストダウンも図っていく考えだ。

SEMICON Japan 2007では、NanoPro NP2-Nを中心に、エッジ検査装置の半導体製造プロセス向けの最新バージョン、新コンセプトの多機能装置などを展示する予定。Siウェーハから半導体製造プロセス、裏面からエッジ・ベベルなど、多様なアプリケーションに対して全面展開する同社の技術や装置を紹介する。



代表取締役社長 高村 淳氏